

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-231798

(P2002-231798A)(43) 公開日 平成14年8月16日(2002.8.16)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FΙ				テーマコート	(参考)
H01L 21/68		H01L 21/6	68		R	4G001	
					N	4K030	
CO4B 35/581		21/2	205			5F004	
H01L 21/205		C23C 16/458 5F031					
21/3065		CO4B 35/9	58	104	Q	5F045	
	審查請才	未請求 請求	求項の数 4	OL	(全9頁	頁) 最終頁	に続く
(21)出願番号	特願2001-24804(P2001-24804)	(71)出願人	. 00000663	33			
			京セラ株	式会社			
(22)出願日	平成13年1月31日(2001.1.31)		京都府京	都市伏	見区竹田	鳥羽殿町6番	昏地
		(72)発明者	阿多利	仁			
		:	鹿児島県	国分市	山下町1	番1号 京七	2ラ株
		式会社鹿児島国分工場内					
		Fターム(を	参考) 4G00	1 BA36	BB36 BC	23 BC32 BC3	5
				BC52	BC54 BD	38	
			4K03	80 FA01	GA02 KA	45 LA15	
			5F00	4 AA01	BA00 BB	18 BB22 BB2	9
			5F03	31 CA02	CA05 HA	.01 HA02 HA0	3
				HA17	PA11		
			5F04	5 AA08	DP02 DQ	10 EM05	

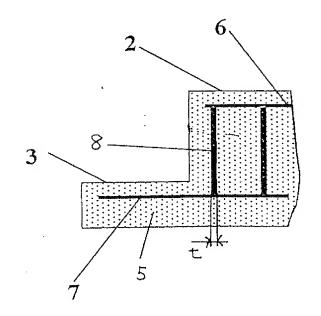
### (54) 【発明の名称】ウエハ支持部材及びその製造方法

## (57) 【要約】

(19)日本国特許庁(JP)

【課題】板状セラミック体中の異なる深さに埋設する2 つの内部電極間における導通を確実に行うことができ、 かつ熱応力によって板状セラミック体が破損することの ないウエハ支持部材を提供する。

【解決手段】ウエハ支持部材1を形成する板状セラミッ ク体3の異なる深さに2つの内部電極6,7と、これら 内部電極6,7間の導通を図る通電部8を埋設し、上記 通電部8は筒状体とし、この筒状体の両端がそれぞれ内 部電極6,7と接して電気的に接続するようにする。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】板状セラミック体の一方の主面をウエハを 載せる載置面とし、上記板状セラミック体の異なる深さ に2つ以上の内部電極と、これら内部電極間の導通を図 る通電部を埋設してなり、上記通電部は筒状体をなし、 該筒状体の両端がそれぞれ上記内部電極と接し電気的に 接続してあることを特徴とするウエハ支持部材。

【請求項2】前記通電部を形成する筒状体の厚みが50 ~1000μmで、かつ上記内部電極間の抵抗値が0. 1Ω以下であることを特徴とする請求項1に記載のウエ 10 ハ支持部材。

【請求項3】前記内部電極が、静電吸着用電極及び/又 はプラズマ発生用電極であることを特徴とする請求項1 又は請求項2に記載のウエハ支持部材。

【請求項4】板状セラミック成形体の上下面を貫通する 貫通孔に導体ペーストを介して上記板状セラミック成形 体と同種のセラミックスからなる柱状セラミック成形体 を埋入し、次いで上記柱状セラミック成形体を覆うよう に上記板状セラミック成形体の上下面にそれぞれ内部電 極を設けた後、これら内部電極をそれぞれ覆うように上 20 記板状セラミック成形体の上下面に、該板状セラミック 成形体と同種のセラミックスからなる薄肉セラミック成 形体を積層して焼成一体化することにより、異なる深さ に2つ以上の内部電極と、これら内部電極間の導通を図 る通電部を埋設した板状セラミック体を製作し、しかる 後、上記板状セラミック体の一方の主面を研磨してウエ ハの載置面を形成することを特徴とするウエハ支持部材 の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラズマ発生機構 を備えたサセプタや、静電吸着機構を備えた静電チャッ ク等のウエハ支持部材に関するものであり、特に半導体 ウエハや液晶用基板などのウエハを保持し、ウエハに成 膜処理を施す成膜装置やエッチング処理を施すエッチン グ装置に好適なものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、半導体装置や液晶装置などの製造 工程においては、半導体ウエハや液晶用ガラス基板など のウエハにエッチング処理や成膜処理を施すため、ウエ 40 ハをウエハ支持部材にて保持することが行われており、 このような支持部材としては、ウエハの反りを防ぐため に強制的に吸着保持させる静電吸着機構を備えたもの や、成膜やエッチング特性を高めるためのプラズマ発生 機構を備えたものがあった。

【0003】図4(a)(b)に従来のウエハ支持部材 の一例を示すように、このウエハ支持部材31は、円盤 状をなし、その外周に鍔部を有する板状セラミック体3 3の上面を、ウエハWを載せる載置面32とするととも

は、その平面形状が円形をした内部電極36を埋設する とともに、上記板状セラミック体33の鍔部中には、そ の平面形状がリング形状をした内部電極37を埋設して あり、各内部電極36、37はそれぞれ板状セラミック 体33の下面に接合された給電端子34,35と電気的 に接続したものがあった。

【0004】そして、このウエハ支持部材31を静電チ ャックとして用いる場合、設置面32にウエハWを載 せ、ウエハWと静電吸着用電極としての内部電極36と の間に直流電圧を印加すると、ウエハWと内部電極36 との間に誘電分極によるクーロン力や電荷移動によるジ ョンソン・ラーベック力等の静電吸着力が発現するた め、ウエハWを設置面32に強制的に吸着固定させるこ とができ、また、内部電極37にも電圧を引加すること により、静電吸着力によってウエハ支持部材31の周辺 に浮遊しているパーティクルを吸着させ、集塵すること ができるようになっていた。

【0005】また、ウエハ支持部材31をプラズマ発生 機構を備えたサセプタとして用いる場合、載置面32に ウエハWを載せ、載置面32の上方に配置された別の上 部電極(不図示)と内部電極36との間に高周波電圧を 印加してプラズマを発生させることにより、ウエハWに 対してプラズマを照射するようになっており、また、上 部電極と内部電極37との間にも高周波電極を引加して プラズマを発生させることにより、ウエハWの外周部で 失われがちであったプラズマ密度の不均一を防止し、ウ エハWの全面に対して均一なプラズマ密度を有するプラ ズマを照射することができるようになっていた。

【0006】ところが、このウエハ支持部材31をチャ ンバーに組み込む際には、各給電端子34,35ごとに 真空シールが必要であったり、また、内部電極37の給 電端子35がウエハ支持部材31の外周部に位置するた め、ウエハ支持部材31の中央に給電端子34,35を 集中させた装置には用いることができないといった不都 合があった。

【0007】そこで、板状セラミック体32中の内部電 極36と内部電極37との導通を図り、内部電極37へ の通電を内部電極36の給電端子34に兼用させること が提案されていた。

【0008】例えば、図5に示す構造は、板状セラミッ ク体33中に埋設された金属メッシュや金属箔からなる 内部電極36と内部電極37との導通を図るのにワイヤ 38を用いたものである。

【0009】また、図6に示す構造は、板状セラミック 体33中に埋設された金属メッシュや金属箔からなる内 部電極36と内部電極37との導通を図るのに中実の金 属棒39を用いたものである。

【0010】さらに、図7に示す構造は、板状セラミッ ク体33中に、直径500μm以下の複数のビアホール に、上記板状セラミック体33中の載置面32側近傍に 50 導体40と、円盤状の導体層からなる電極パッド41と

を交互に積み重ねて形成した導通部を設け、内部電極36と内部電極37との導通を図ったものである。

#### [0011]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図5に示す構造を有する板状セラミック体33を製作するには、ワイヤ38を介して接続した内部電極36と内部電極37を埋設してなるセラミック成形体をホットプレス法等の手段を用いて焼結させることにより製作されるのであるが、加圧時にセラミック粉体が流動することに伴うワイヤ38の変形や焼成時におけるセラミック粉体の収縮に10よるワイヤ38の変形等によってワイヤ38が断線し、内部電極37の通電が行えなくなるといった課題があった。

【0012】また、図6に示す構造を有する板状セラミック体33を製作するには、中実の金属棒39が用いられるため、板状セラミック体33との熱膨張差の小さな材質を用いたとしても、板状セラミック体33と金属棒39との界面に大きな熱応力が発生し易いものであった。しかも、板状セラミック体33を成形する際には、金属棒39の周囲が他の部分と比較してセラミックスの20充填密度が疎になり易く、金属棒39周囲の強度が他の部分と比較して低かった。

【0013】その為、熱が加わる環境下で使用すると、 金属棒39周囲の強度が低下していることと、熱応力の 作用によって板状セラミック体33が破損するといった 恐れがあった。

【0014】さらに、図7に示す構造を有する板状セラ ミック体33を製作するには、ビアホール導体40を備 えたセラミックグリーンシートと、電極パッド41を備 えたセラミックグリーンシートと、内部電極36,37 を備えたセラミックグリーンシートと、何も形成されて いないセラミックグリーンシートとをそれぞれ図7に示 すような構造となるように所定の順序で積み重ねて形成 したセラミック成形体を焼成することにより製作するの であるが、ビアホール導体40と内部電極36,37や 電極パッド41との接触面積を大きくすることができな いため、例えばプラズマ発生させるために内部電極3 6,37に高周波電力を印加すると、ビアホール導体4 0と内部電極36,37との接触部や、ビアホール導体 40と電極パッド41との接触部が発熱したり、高周波 40 により励起されるプラズマが不均一となり、また、静電 吸着力を発現させるために内部電極36、37に直流電 圧を印加すると、内部電極37によるパーティクルの集 塵特性が低下するといった課題があった。

【0015】即ち、ビアホール導体 40 と内部電極 36, 37 や電極パッド 41 との接触面積を大きくするためにビアホール導体 40 の径を 500  $\mu$  m以上にすると、焼成時のビアホール導体 40 と板状セラミック体 30 収縮差により欠陥が発生するため、500  $\mu$  m以上の径を有するビアホール導体 40 を形成することができ 50

ず、また、ビアホール導体40の数を多くすると、導通 部周囲のセラミックスの強度が低下するため、熱が加わ る環境下で使用すると、導通部周囲の強度低下や熱応力 によって板状セラミック体33が破損するといった恐れ があった。

4

#### [0016]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は上記課題に鑑み、請求項1に係る発明は、ウエハ支持部材を形成する板状セラミック体の異なる深さに2つ以上の内部電極と、これら内部電極間の導通を図る通電部を埋設し、上記通電部は筒状体とし、この筒状体の両端がそれぞれ内部電極と接して電気的に接続されるようにしたことを特徴とする。

【0017】請求項2に係る発明は、上記通電部を形成する筒状体の厚みが $50\sim1000\mu$ mで、かつ内部電極間の抵抗値が $0.1\Omega$ 以下であることを特徴とする。【0018】請求項3に係る発明は、上記内部電極が、静電吸着用電極及び/又はプラズマ発生用電極であることを特徴とする。

【0019】請求項4に係る発明は、板状セラミック成形体の上下面を貫通する貫通孔に導体ペーストを介して上記板状セラミック成形体と同種のセラミックスからなる柱状セラミック成形体を埋入し、次いで上記柱状セラミック成形体を覆うように上記板状セラミック成形体の上下面にそれぞれ内部電極を設けた後、これら内部電極をそれぞれ覆うように上記板状セラミック成形体の上下面に、該板状セラミック成形体と同種のセラミックスからなる薄肉セラミック成形体を積層して焼成一体化することにより、異なる深さに2つ以上の内部電極と、これら内部電極間の導通を図る通電部を埋設した板状セラミック体を製作し、しかる後、上記板状セラミック体の一方の主面を研磨してウエハの載置面を形成することによりウエハ支持部材を製造することを特徴とする。

#### [0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

【0021】図1 は本発明のウエハ支持部材の一例を示す図で、(a) はその斜視図、(b) は(a) のX-X 線断面図であり、また、図2 は図1 (b) の2部を拡大した断面図である。

【0022】このウエハ支持部材1は、円盤状をなし、その外周に鍔部5を有する板状セラミック体3の上面を、ウエハWを載せる載置面2とするとともに、上記板状セラミック体3中の載置面2側近傍には、その平面形状が円形をした内部電極6を埋設するとともに、上記板状セラミック体3の鍔部5中には、その平面形状がリング形状をした内部電極7を埋設してあり、内部電極6と内部電極7とは板状セラミック体3中において筒状体をした通電部8と接し電気的に接続されており、また、内部電極6は板状セラミック体3の下面中央に接合された

給電端子4と電気的に接続してある。

【0023】そして、このウエハ支持部材1を静電チャ ックとして用いる場合、設置面2にウエハWを載せ、ウ エハWと静電吸着用電極としての内部電極6との間に直 流電圧を印加すると、ウエハWと内部電極6との間に誘 電分極によるクーロン力や電荷移動によるジョンソン・ ラーベック力等の静電吸着力が発現するため、ウエハW を設置面2に強制的に吸着固定させることができ、ま た、内部電極7にも電圧が引加されるため、静電吸着力 によってウエハ支持部材1の周辺に浮遊しているパーテ 10 ィクルを鍔部5の表面に吸着させ、集塵することがで き、また、ウエハ支持部材1をプラズマ発生機構を備え たサセプタとして用いる場合、載置面2にウエハWを載 せ、載置面2の上方に配置された別の上部電極(不図 示)と内部電極6との間に高周波電圧を印加してプラズ マを発生させることにより、ウエハWに対してプラズマ を照射することができ、また、上部電極と内部電極7と の間にも高周波電が引加されるためにプラズマを発生さ せることにより、ウエハWの外周部で失われがちである プラズマ密度の不均一を防止し、ウエハWの全面に対し 20 て均一なプラズマ密度を有するプラズマを照射すること ができる。

【0024】そして、本発明のウエハ支持部材1によれ ば、板状セラミック体3中の異なる深さに埋設された2 つの内部電極6,7間の導通を図る通電部8を筒状体と し、その開口端部全体が各内部電極6,7と当接させる ことができるため、各内部電極6,7との接触面積を大 きくすることができるとともに、通電部8をなす筒状体 の内側と外側のセラミックスが同種のものであり、ま た、筒状体からなる通電部8は厚みを薄くすることがで 30 きるため、焼成時や加熱されるような雰囲気下で使用さ れたとしても、通電部8と板状セラミック体3との間に 作用する応力を抑えることができるため、板状セラミッ ク体3が破損するようなことがなく、簡単な構造で長期 間にわたって確実な通電を実現することができる。

【0025】ところで、板状セラミック体3を形成する 材質としては、アルミナ、窒化珪素、窒化アルミニウム を主成分とするセラミック焼結体を用いることができ、 例えば、窒化アルミニウム質焼結体であれば、窒化アル ミニウム90~98重量%、Y,O,に代表される希土類 40 元素酸化物を2~6重量%、アルミナを0.5~2重量 %、さらにCaOを0~1重量%含有するものを用いれ ば、優れた熱伝導率を有する板状セラミック体3を得る ことができ、また、アルミナ質焼結体であれば、アルミ ナ98~99.8重量%、MgOO.2~2重量%、S iO,0~1.0重量%を含有するものを用いれば、ハ ロゲンガスに対する耐食性に優れた板状セラミック体3 を得ることができる。

【0026】また、内部電極6,7や導通部8は、板状

とが良く、例えば、タングステン、モリブデン、チタ ン、白金等の金属やその合金を用いることができる。ま た、内部電極6,7や導通部8は同一材質により形成す ることが好ましい。

【0027】さらに、前述したように、焼成時や加熱さ れるような雰囲気下で導通部8周辺に発生する熱応力を 緩和するためには、導通部8を形成する筒状体の厚みt を50~1000 µmとすることが重要である。

【0028】ここで、通電部8をなす筒状体の厚み tを  $50\sim1000\mu$ mとしたのは、この厚み t を  $50\mu$ m 未満とすることは製造上難しいからであり、逆に厚みt が1000μmを超えると、後述する製造方法との関係 により通電部8周辺に未焼結部が生じて部分的に強度が 低下したり、通電部8の比抵抗が上昇して電極としての 信頼性が低下するからである。

【0029】即ち、通電部8は、図3(b)に示すよう に、未焼成の板状セラミック成形体20に貫通孔21を 形成し、この貫通孔21の内壁面に導体ペースト22を 塗布した後、貫通孔21に上記板状セラミック成形体2 0と同種のセラミックスからなる未焼成の柱状セラミッ ク成形体19を挿入し、貫通孔21と柱状セラミック成 形体19との隙間に充填された導体ペースト24を焼結 させることにより製造するのであるが、導体ペースト2 2中には有機成分が含有されており、この有機成分は焼 成時に貫通孔21周囲のセラミック中に拡散し、通電部 8をなす筒状体の厚み t が厚くなると、その分セラミッ ク中に拡散する有機成分の量も増加することになる。そ して、通電部8をなす筒状体の厚み t が1000μmを 超えると、通電部8周囲のセラミック中には多量の有機 成分が拡散することになるために未焼結部分として残っ てしまうとともに、通電部8の比抵抗が上昇してしまう からである。

【0030】また、内部電極6,7に高周波電力や直流 電圧を安定して印加するには、内部電極6,7と通電部 8間の抵抗値を 0. 1Ω以下とすることが必要であり、 上記寸法範囲の通電部8を前述した材料にて形成するこ とにより得ることができる。

【0031】なお、本実施形態では、通電部8の形状と して筒状体をしたものを用いたが、その平面形状につい ては特に限定するものではなく、円形、楕円形、多角形 などさまざまな平面形状をとることができる。

【0032】次に、図1及び図2に示すウエハ支持部材 の製造方法について説明する。

【0033】まず、未焼成の板状セラミック成形体20 を用意し、その主面より切削バイトを用いたヘリカル加 工にて、図3 (a) に示すような貫通孔21を穿孔す る。ここで、貫通孔21の平面形状としては特に限定す るものではなく、円形や楕円形あるいは多角形をしたも のでも構わない。また、後述するように、貫通孔21中 セラミック体3との熱膨張差が近似した材質を用いるこ 50 への柱状セラミック成形体19の挿入を容易するため、

貫通孔21の開口部にテーパーを設けても構わない。 【0034】次に、この貫通孔21に通電部8となる導 体ペースト22を塗布あるいは充填したあと、図3

(b) に示すように、板状セラミック成形体20と同種 のセラミックスからなる柱状セラミック成形体19を挿 入する。この時、柱状セラミック成形体19の寸法は、 貫通孔21より小径とし、焼成後においては、貫通孔2 1と柱状セラミック成形体19との間隔、即ち焼成後に おける筒状体の厚み t が 5 0 ~ 1 0 0 0 μ mとなるよう にしておく。

【0035】なお、柱状セラミック成形体19を貫通孔 21に挿入するにあたり、柱状セラミック成形体19と 貫通孔21との間隔を一定にするため、該間隔に相当す る複数本のピンを柱状セラミック成形体19と貫通孔2 1との隙間に挿入するか、あるいは他の方法として、貫 通孔21の内壁面あるいは柱状セラミック成形体19の 外壁面に、間隔に相当する複数の突起を形成しておいて も構わない。

【0036】しかる後、図3(c)に示すように、板状 内部電極6,7の形状に敷設するか、あるいはメッシュ やパンチングメタル等のバルク体を配置し、バルク体と 貫通孔21中の導体ペーストとの接点に、導体ペースト を塗布して接触させ、その後、図3 (d) に示すよう に、板状セラミック成形体20と同質のセラミックスか らなる薄肉セラミック成形体23を重ねてゴム型でくる み、冷間静水圧プレスを施したあと焼成するか、あるい はホットプレスすることにより、図1に示すように、内 部電極6,7と筒状体をした通電部8を埋設してなり、 通電部8の開口端部が内部電極6,7と接した状態で電 30 気的に接続された板状セラミック体3を製作する。

【0037】その後、内部電極6が埋設されている側の 板状セラミック体3の表面を研磨してウエハWの設置面 2を形成し、該設置面2と内部電極6との距離を0.1 ~1.5mmとすることにより本発明のウエハ支持部材 1を得ることができる。

【0038】以上のような方法にて製造することによ り、通電部8周囲のセラミックスは他の部分と同程度に 充分に緻密化されていることから、焼成後において通電 部8周囲の強度低下を生じることがなく、また簡単な構 40 造で内部電極6,7間の導通を確実にとることができる 通電部を容易に製造することができる。

#### [0039]

【実施例】(実施例1)図2に示す通電部8を有する本 発明のウエハ支持部材1と、図5,6,7に示す通電部 を有する従来のウエハ支持部材31とをそれぞれ20個 ずつ用意し、熱サイクル試験を行った後、各通電部8に て接続された内部電極6,7,36,37間の抵抗値の 劣化状況について調べる実験を行った。

【0040】まず、各ウエハ支持部材1,31の製法に 50

ついて説明する。

【0041】図2に示す通電部8を有する本発明のウエ ハ支持部材は、外径250mm、厚み15.5mmの窒 化アルミニウムからなる板状セラミック成形体20に、 直径5mm、深さ5mmの貫通孔21を穿孔し、この貫 通孔21の内壁面にタングステンの導体ペースト22を 塗布した後、外径5.0mm、長さ4.75mmの窒化 アルミニウムからなる柱状セラミック成形体19を貫通 孔21の内壁面と接触しないように挿入し、溢れ出た導 10 体ペースト22を除去した。次に、貫通孔21を覆うよ うに板状セラミック成形体20の表面に、導体ペースト 25を0.05mmの厚みにスクリーン印刷したあと、 外径250mm、厚み10mmの窒化アルミニウムから なる薄肉セラミック成形体23を2枚、表裏から重ね、 静水圧プレスを施すことにより一体化し、一体化した薄 肉セラミック成形体の表面を切削加工して全体厚みを2 8mmとした後、1900℃の窒素雰囲気中で焼結する ことにより、外径200mm、厚み17.8mmの円盤 状をなし、内部に内部電極6,7と、筒状体をした通電 セラミック成形体20の表面に、導体ペースト膜25を 20 部8を埋設してなる板状セラミック体3を製作した。ま た、この板状セラミック体3を切断し、内部に埋設され ている筒状の通電部8の寸法を測定したところ、外径が 約4mm、高さが約4mm、厚みが約0.25mmであ った。

> 【0042】次いで、内部電極6が埋設されている側の 板状セラミック体3の表面に研削加工を施して設置面2 を形成し、設置面2から内部電極6までの距離を0.5 mmとすることにより本発明のウエハ支持部材1,31 を製作した。

【0043】また、図5,6に示す通電部を有する従来 のウエハ支持部材31は、モリブデン製のメッシュから なる内部電極36,37と、線径が0.5mm、長さが 6mmのモリブデン製のワイヤ38からなる通電部を用 いたもの(図5)と、外径2mm、長さが5mmのモリ ブデン製の中実金属棒39で接続したもの(図6)を型 の所定位置にセットし、型内に窒化アルミニウム粉末を 充填した後、ホットプレスにて焼成することにより、外 径200mm、厚み17.8mmの円盤状をなし、内部 に内部電極36,37と、ワイヤ38又は金属棒39を 埋設してなる板状セラミック体33を製作した。

【0044】次いで、内部電極36が埋設されている側 の板状セラミック体33の表面に研削加工を施して設置 面32を形成し、設置面32から内部電極36までの距 離を0.5mmとすることにより従来のウエハ支持部材 31を製作した。

【0045】さらに、図7に示す通電部を有する従来の ウエハ支持部材31は、ビアホール導体40を備えた窒 化アルミニウムのグリーンシートと、電極パッド41を 備えた窒化アルミニウムのグリーンシートと、内部電極 36,37を備えた窒化アルミニウムのグリーンシート

9

と、何も形成されていない窒化アルミニウムのグリーンシートとをそれぞれ図7に示すような構造となるように所定の順序で積み重ねて形成した積層体を、1900 の窒素雰囲気下で焼結することにより、外径200mm、厚み17.8 mmの円盤状をなし、内部に内部電極36,37と、ビアホール導体40及び電極パッド41とからなる通電部を埋設してなる板状セラミック体33を製作した。なお、内部電極36,37、ビアホール導体40、パッド41はいずれもタングステンを用いた。

【0046】次いで、内部電極36が埋設されている側 10 の板状セラミック体33の表面に研削加工を施して設置面32を形成し、設置面32から内部電極36までの距

離を0.5mmとすることにより従来のウエハ支持部材31を製作した。

【0047】そして、これらのウエハ支持部材1,31 を給電端子4,34の接合部の温度が600℃となるように外部熱源で加熱した後、600℃の温度で10分間保持し、冷風機で常温まで急冷させるサイクルを1サイクルとする熱サイクル試験を施し、50サイクル及び200サイクル後の内部電極6,7,36,37間の抵抗変化を測定した。

【0048】その結果を表1に示す。

[0049]

【表1】

試料 No.	内部電極間の 導通構造	電極との距離	板状セラミック体の製作時に載置面と内部電極との絶縁性 が保てなかったものの個数	おける内部電極間の抵抗値が0.10以下であっ	20サイクル後における 内部電極間の抵抗値変 動が10%以下であった ものの個数
1+	図5	0.5	16	f 6	4
2*	図6	0.5	14	13	9
3*	図7	0.5	20	19	16
4	図2	0.5	20	20	20

\*は従来例のものである。

【0050】この結果、図5,6に示す通電部を有する従来のウエハ支持部材31は、ワイヤ38や金属棒39の接続部が、内部電極36を貫通しているため、図5のウエハ支持部材31においては20個中4個が、図6のウエハ支持部材31においては20個中6個において、ワイヤ38や金属棒39の接続部が載置面32より露出し、載置面32と内部電極36の絶縁を保てなかった。【0051】また、熱サイクル試験前における内部電極36,37間の抵抗値が0.1Ωを超えたものは、図5のウエハ支持部材31が4個、図6のウエハ支持部材31が7個も発生し、20サイクル後における抵抗値の変動が10%以下であったものは、図5のウエハ支持部材31で4個、図6のウエハ支持部材31で4個、図6のウエハ支持部材31で9個しか残らなかった。

【0052】また、図7に示す通電部を有する従来のウエハ支持部材31では、20個全てが載置面32から内部電極36までの良好な絶縁を示したが、熱サイクル試

験前の内部電極36,37間の抵抗値が0.1 $\Omega$ を超えたものが1個発生し、20サイクル後における抵抗値の変動が10%以下であったものは16個であった。

【0053】これに対し、図2に示す通電部8を有するウエハ支持部材1は、20個全ての試料において載置面2から内部電極6までの良好な絶縁が得られ、内部電極6,7間の抵抗値も0.1 $\Omega$ を超えるものはなく、また20サイクルの熱サイクル試験後でも内部電極6,7間の抵抗値が0.1 $\Omega$ を超えるものはなく、歩留り良く製造でき、信頼性の点で優れていた。

(実施例 2)そこで、実施例 1 における本発明のウエハ支持部材 1 において、通電部 8 をなす筒状体の厚み 1 を異ならせた時の板状セラミック体 3 の破損の有無について調べる実験を行った。

【0054】結果を表2に示した。

[0055]

【表2】

	通電部をなす 筒状体外径 (mm)	通電部をなす 筒状体の内径 (mm)	通電部をなす情状 体の厚み(mm)	内部電極間の抵抗(Ω・ cm)	板状セラミック体のクラック の有無
*5	<b>*1.0</b>	0.94	0.03	ii	無し
*6	*1.5	0.5	0.50	<0.001	有り(導体内)
7	2.0	0.5	0.75	<0.001	無し
9	5.0	4.9	0,05	₹0,000	無し
9	10.0	8.0	1.00	<0.001	無し
*10	10.0	7.0	*1.50	<0.001	有り(導体内)
11	10.0	9.0	0.50	<0.001	無し
12	12.0	10.5	0.75	<0.001	無し
13	30.0	28.0	1.00	₹0.001	無し
*14	30,0	23.0	* 3.50	<0.001	有り(柱状体内)

\* は本発明範囲外のものである。

注) 戦 置面から内部電極までの距離は0.5mmである。

【0056】この結果、通電部8をなす筒状体の厚みt 50 が1000μmを超えると、通電部8周囲のセラミック

12

スにクラックが発生したのに対し、通電部8をなす筒状 体の厚み t を 5 0 ~ 1 0 0 0 μ m の範囲で形成したもの では、板状セラミック体3に破損は見られなかった。

11

【0057】この結果、通電部8をなす筒状体の厚みt は $50\sim1000\mu$ mの範囲で形成することが良いこと が判る。

#### [0058]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、ウエハ 支持部材を形成する板状セラミック体の異なる深さに2 つ以上の内部電極と、これら内部電極間の導通を図る通 10 電部を埋設し、上記通電部は筒状体とし、この筒状体の 両端がそれぞれ内部電極と接して電気的に接続されるよ うにしたことによって、通電部周囲のセラミックスの強 度劣化を抑えることができるとともに、通電部とセラミ ックスとの接合部における熱応力の発生を抑えることが できるため、熱応力が作用するような環境下で使用して も通電部周囲のセラミックスにクラック等の破損を生じ ることがなく、また、内部電極と通電部との間の電気の 流れを阻害することなく確実に接続することができ、通 電部を介した内部電極間の抵抗値を常に0.1Ω以下に 20 保つことができるため、長期間にわたり安定して内部電 極に通電することができる。

【0059】その為、内部電極を静電吸着用電極として 用いれば、均一な吸着力を発現させ、反りのあるような ウエハを確実に設置面にならって保持させることがで き、さらに、ウエハ支持部材周囲に浮遊するパーティク ルを効果的に吸着させて集塵することができ、また、内 部電極をプラズマ発生用電極として用いれば、ウエハの 外周部においても均一なプラズマを発生させることがで きるため、載置面に保持したウエハ上への成膜やエッチ 30 ング速度を向上させることができる。

【0060】また、本発明によれば、板状セラミック成 形体の上下面を貫通する貫通孔に導体ペーストを介して 上記板状セラミック成形体と同種のセラミックスからな る柱状セラミック成形体を埋入し、次いで上記柱状セラ ミック成形体を覆うように上記板状セラミック成形体の 上下面にそれぞれ内部電極を設けた後、これら内部電極 をそれぞれ覆うように上記板状セラミック成形体の上下 面に、該板状セラミック成形体と同種のセラミックスか らなる薄肉セラミック成形体を積層して焼成一体化する 40 41:電極パッド ことにより、異なる深さに2つ以上の内部電極と、これ

ら内部電極間の導通を図る通電部を埋設した板状セラミ ック体を製作し、しかる後、上記板状セラミック体の一 方の主面を研磨してウエハの載置面を形成することによ りウエハ支持部材を製造するようにしたことから、通電 部の周囲の強度低下を生じることなく、簡単な構造で確 実に内部電極間の導通を図ることができるため、ウエハ 支持部材を歩留り良く簡単に製造することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のウエハ支持部材の一例を示す図で、

(a) はその斜視図、(b) は(a) のX-X線断面図

【図2】図1(b)のZ部を拡大した断面図である。

【図3】(a)~(d)は本発明に係るウエハ支持部材 の製造方法を説明するための模式図である。

【図4】従来のウエハ支持部材の一例を示す図で、

(a) はその斜視図、(b) は(a) のY-Y線断面図 である。

【図5】従来のウエハ支持部材における内部電極間の通 電構造を部分的に拡大した断面図である。

【図6】従来のウエハ支持部材における内部電極間の他 の通電構造を部分的に拡大した断面図である。

【図7】従来のウエハ支持部材における内部電極間のさ らに他の通電構造を部分的に拡大した断面図である。

#### 【符号の説明】

1,31:ウエハ支持部材

2, 32:載置面

3, 33:板状セラミック体

4,34,35:給電端子

5:鍔部

6,36:内部電極

7, 37:内部電極

8:通電部

19:柱状セラミック成形体

20:板状セラミック成形体

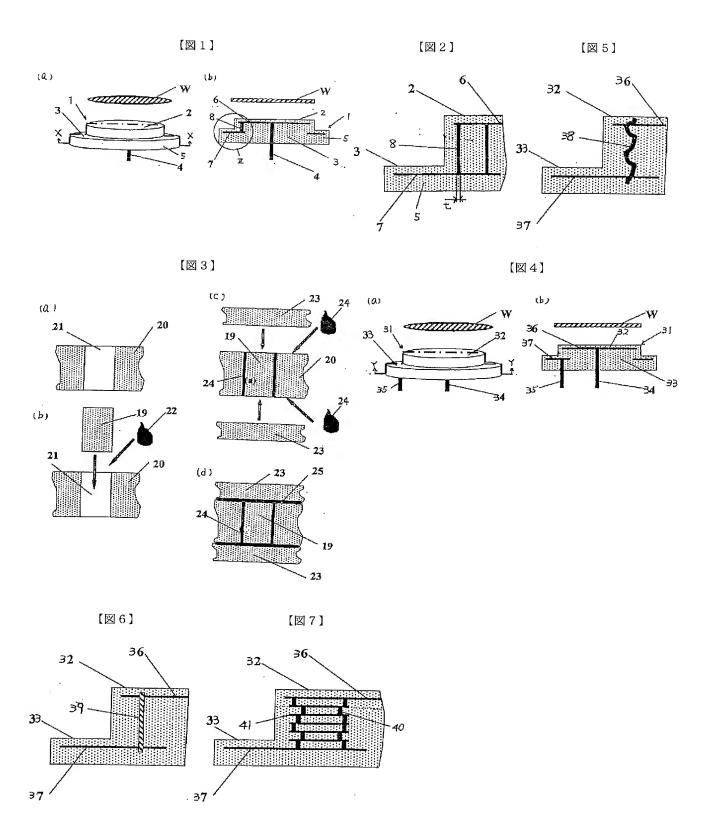
21: 貫通孔

22: 導体ペースト

23:薄肉セラミック成形体

24: 導体ペースト

40:ピアホール導体



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7 // C 2 3 C 16/458

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 4 B 35/58

1 0 4 Y

H O 1 L 21/302

В

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-231798

(43)Date of publication of application: 16.08.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 CO4B 35/581 H01L 21/205 H01L 21/3065 // C23C 16/458

(21)Application number: 2001-024804

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

31.01.2001

(72)Inventor:

**ATARI HITOSHI** 

## (54) WAFER RETAINER AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wafer retainer wherein electrical continuity between two inner electrodes which are buried at different depths in a plate-like ceramic member can be surely obtained, and the plate-like ceramic member is not damaged by thermal stress.

SOLUTION: The inner electrodes 6, 7 which are buried at different depths and current carrying part 8 which realizes electrical continuity between the inner electrodes 6, 7 are buried in the plate-like ceramic member 3 forming the wafer retainer 1. The current carrying part 8 is constituted as a cylindrical body, and both ends of the cylindrical body are brought into contact with the inner electrodes 6, 7, realizing electrical connection.

